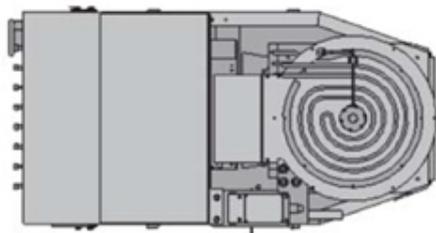
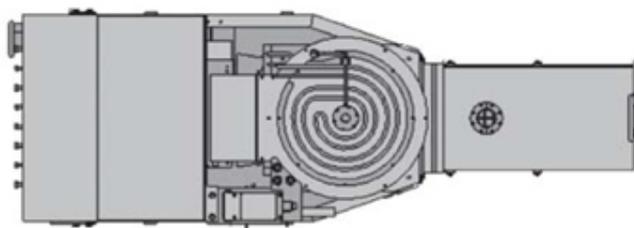


Установка плазмохимического осаждения Versaline PECVD

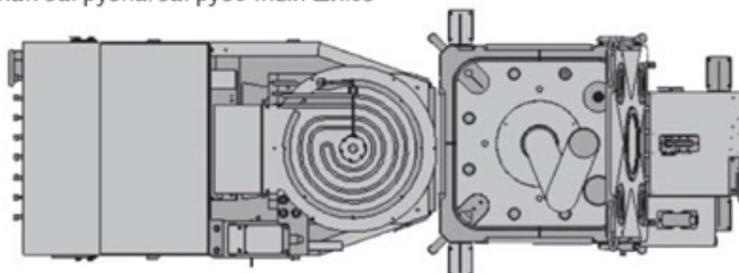
Ручная загрузка одной пластины или партии пластин



Одна пластина/загрузочный шлюз



Кассетная загрузка/загрузочный шлюз



Производитель:

Plasma-Therm

Цена:

Цена по запросу

Описание

Plasma-Therm Versaline — это современная, надежная, высокопроизводительная платформа, на базе которой реализованы процессные модули всех ключевых типов плазменных процессов травления и осаждения материалов: RIE, RIE-ICP, PECVD, HDPCVD, DSE. Все процессные модули на платформе Versaline имеют стандартный механический интерфейс MESG и могут быть оснащены различными загрузчиками подложек, в зависимости от масштаба производства:

- автоматический шлюз — для R&D-лабораторий и мелкосерийных производств;

- автоматический кассетный загрузчик — для пилотных и серийных производств;
- роботизированный загрузчик, объединяющий модули в кластер, — для крупносерийных производств.

Установка Plasma-Therm Versaline PECVD в исполнении с автоматическим шлюзом предназначена для плазмостимулированного осаждения из газовой фазы.

Установка идеально подходит для решения стандартных задач осаждения SiO₂ и Si₃N₄ в том случае, когда необходима высокая производительность, низкая стоимость процесса и технического обслуживания системы.

Установка Plasma-Therm Versaline PECVD позволяет осаждать следующие виды материалов:

- Диэлектрики: SiO₂, SiN_x, SiO_xN_y;
- Полупроводниковые материалы: SiC, a-Si.

Ключевые преимущества установки Versaline PECVD:

- Максимальный размер обрабатываемой подложки 200 мм, поштучная обработка.
- Равномерность осаждаемого покрытия по толщине и воспроизводимость результатов от пластины к пластине: типично лучше $\pm 2\%$.
- Наличие вакуумного шлюза в базовой комплектации.
- Повышенная безопасность и чистота процесса за счет шлюзовой загрузки.
- В комплекте с установкой поставляется библиотека стандартных технологических процессов, которые гарантируются производителем.
- Простой, интуитивно понятный интерфейс.
- Программное обеспечение позволяет записывать параметры процессов для дальнейшего анализа.
- История аварийных сообщений, контроль рецептов в процессе работы — вывод данных о процессе на дисплей в режиме реального времени.
- Многоуровневый доступ пользователей.
- Возможность удаленного управления и контроля состояния системы.
- Наличие различных вариантов системы отслеживания окончания процесса (OES, OEI, LEPD).
- Простота использования и обслуживания.
- Малая занимаемая площадь.
- Возможность установки через стену чистого производственного помещения.
- Возможность замены шлюза автоматическим кассетным загрузчиком или роботом.

Стандартная комплектация

- Система отслеживания окончания процесса:
 - Оптическая эмиссионная спектроскопия (OES)
 - Оптическая эмиссионная интерферометрия (OEI)
 - Лазерная интерферометрия (LEPD)
- Дополнительные газовые линии (до 8 в сумме),
- Специальные держатели образцов,
- Нагреватели вакуумной камеры и вакуумного тракта,
- Пакет для установки через стенку ЧПП: два варианта,
- Расширенная гарантия производителя